

ベンゼンに係る指定物質排出施設及び指定物質抑制基準

指定物質排出施設（政令で指定）	指定物質抑制基準（告示で設定）の概要
一 ベンゼン（濃度が体積百分率 60 パーセント以上のものに限る。以下同じ。）を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり 1,000 立方メートル以上のもの	溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。 既設：200 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上 3,000 m ³ N/h 未満) 100 mg/m ³ N(排ガス量 3,000 m ³ N/h 以上) 新設：100 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上 3,000 m ³ N/h 未満) 50 mg/m ³ N(排ガス量 3,000 m ³ N/h 以上)
二 原料の処理能力が1日当たり 20 トン以上のコークス炉	装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用。 既設：100 mg/m ³ N(特殊構造炉の適用除外あり) 新設：100 mg/m ³ N
三 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設（常圧蒸留施設を除く。）	溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。 既設：200 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上) 新設：100 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上)
四 ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設（密閉式のものを除く。）	フレアスタックで処理するものを除外。 既設：100 mg/m ³ N 新設：50 mg/m ³ N
五 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が 500 キロリットル以上のもの	浮屋根式のもの除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。 既設：1,500 mg/m ³ N(容量 1,000 kl 以上) 新設：600 mg/m ³ N
六 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり 1 トン以上のもの（密閉式のものを除く。）	フレアスタックで処理するものを除外。 既設：200 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上 3,000 m ³ N/h 未満) 100 mg/m ³ N(排ガス量 3,000 m ³ N/h 以上) 新設：100 mg/m ³ N(排ガス量 1,000 m ³ N/h 以上 3,000 m ³ N/h 未満) 50 mg/m ³ N(排ガス量 3,000 m ³ N/h 以上)

トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る 指定物質排出施設及び指定物質抑制基準

指定物質排出施設（政令で指定）	指定物質抑制基準（告示で設定）の概要
七 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン（以下「トリクロロエチレン等」という。）を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり 1,000 立方メートル以上のもの	溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定。 既設：500 mg/m ³ N 新設：300 mg/m ³ N
八 トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が5キロリットル以上のもの（密閉式のものを除く。）	溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定。 既設：500 mg/m ³ N 新設：300 mg/m ³ N
九 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設（密閉式のものを除く。）	トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定。 既設：300 mg/m ³ N 新設：150 mg/m ³ N
十 トリクロロエチレン等による洗浄施設（次号に掲げるものを除く。）であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3平方メートル以上のもの	既設：500 mg/m ³ N 新設：300 mg/m ³ N
十一 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり 30 キログラム以上のもの	密閉式のもの除外。 既設：500 mg/m ³ N 新設：300 mg/m ³ N